

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【公開番号】特開2011-233597(P2011-233597A)

【公開日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-046

【出願番号】特願2010-100298(P2010-100298)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/20 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/20

【手続補正書】

【提出日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 9】

そして、図 4 に示すように、ガラス基板 2 0 を図中右方へ移動させる。そうすると、ガラス基板 2 0 の位置が、ピッチ P の 3 倍の距離だけ移動した時点で、マイクロレンズ 5 及びマスク 3 の下方にマイクロレンズ 5 の 3 列分の幅だけ入り込む。そして、この時点で、レーザ光 3 0 を 1 ショット照射する。そうすると、アモルファスシリコン膜 2 2 においては、ピッチ P の 3 列分のマイクロレンズ 5 により集光された領域 1 0 がレーザ光により加熱されて昇温し、熔融凝固して、この領域 1 0 が結晶化する。これにより、この 3 列分の領域 1 0 がポリシリコン膜となる。3 列分のマイクロレンズ 5 以外のマイクロレンズ 5 には、遮光板 7 により遮光されてレーザ光は照射されない。